High Power test of C-band RF window Using Resonant Ring

T.Takenaka¹⁾,H.Katagiri, K.Nakao, S.Michizono, S.Fukuda KEK,High Energy Accelerater Research Organization 1-1 Oho,Tsukuba,Ibaraki,305-0801,Japan

Abstract

High power test of C-band rf window is carried out using a resonant ring. The window is the mix-mode type developed last year, where the electric fields decrease at the periphery. Rf power of the maximum 350 MW is transmitted through the window. During the resonant-ring test, optical emission is measured and analyzed through spectrometer, which indicates the good durability for the high-power usage.

Cバンド-レゾナントリングを用いた高周波窓の大電力試験

1.はじめに

KEK電子陽電子入射器において検討しているCバンド化計画⁽¹⁾では、40MWの高周波出力を加速管に投入する。昨年はCバンドクライストロンの40MW出力に使用できる窓を目指し、160MWの試験をおこなった。

昨年、試験をした窓は現在クライストロンギャラ リーに使用されており、第一の目的は達した。高周 波窓の耐性を評価するために300MWを目標に試験 を行った⁽²⁾。

レゾナントリング(Fig.1)では、クライストロ ンから発生する2倍,3倍の高調波はカットされるが、 基本波出力を同期・重畳させることにより、10~20 倍の通過電力を得ることができる。レゾナントリン グの運転周波数の波長と整合をとるため、スペーサ を挿入して粗調整を行い、運転周波数により微調整 を行っている。レゾナントリングは大電力高周波源 で用いられる各種部品(高周波窓、フランジ、導波 管等)の開発に適しており、今回も導波管回路に用 いる高周波窓の評価を行った。

最初は高周波窓の挿入部分を直接、直管で組み、 充分にガス出しをした後に高周波窓の試験を行って いる。レゾナントリングへの入力は繰り返しとパル ス幅等を徐々にあげながらおこなった。前回に比べ 2倍強の300MW ~ 350MWのパワーだった為フラン ジ、窓の温度上昇にも気を配った。

高周波窓の試験では前回をはるかに越えるパワー を投入するので表面溶融が懸念された。高周波窓の 試験評価には発光の確認と同時に発光分析も行った。

また、前回の試験と比較するため、窓の高周波損 失測定も行われた。

ここでは昨年を大きく上回る大電力での直管およ び高周波窓の試験と発光分析などについて報告する。



Fig.1 Cバンドレゾナントリング(周長約3.9m)

2.最大通過電力

最初、通過電力評価試験は直管にて行われ、Fig.2 に示すように最大通過電力403MW、パルス幅2≪s、 繰り返し50ppsを達成した。通過電力350MWではパ ルス幅2≪s、繰り返し50ppsで数時間運転された。

次に高周波窓に取り替えて評価試験をした。Fig.3 は300MW連続運転時のパルス波形を示し、Fig.4に は9時間連続運転を行ったときの通過電力と真空圧 力を示してある。このデータを見るとレゾナントリ ングでの真空悪化による3回のトリップがあったが 真空は時間とともに良くなっており、充分期待でき る。

なお、高周波窓での最大通過電力は350MW、1 ∞、25ppsに達することが出来た。繰り返しを50pps にするとフランジ等の温度上昇が大きくなりレゾナ ントリングのチューニング調整が頻繁になった為、 今回の試験は基本的に25ppsとした。

¹ E-mail:tateru.takenaka@kek.jp

Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)



Fig.4 300MW高周波窓通過電力と真空圧力

直管を用いたときの通過電力378MW、25ppsでフ ランジ部の温度は48.7度、導波管部は39度になった。 高周波窓では300MW、25pps運転のとき同調の最適 化を行うため挿入した35mmスペーサで45.6度、接 合フランジで42度となっていた。また、放射線レベ ルは15≪Sv/hであった。

3. 直管・高周波窓のコンディショニング

直管のコンディショニングは昨年160MWを8日 間で行ったが、今回は300MW、10日間であった。 高周波窓のコンディショニングは直管で既に 400MWまで通過していたので高周波窓以外での反 射が生じず350MWまで5日間で到達し300MWの9時 間連続運転までには8日間でおこなえた。コンディ ショニングの方法として高周波電力のパルス幅を短 く、繰り返しを少なくして運転すると早い段階で大 電力まで到達し、あとのコンディショニングが比較 的楽であった。

コンディショニング終了後、窓の真空漏れ試験を したが、漏れはなかった。

4. 高周波窓の高周波損失

高周波損失は水晶温度計を用いセラミック窓外導体の入出力流量の温度差を測定した。そのときの流量は11/min。高周波損失(Fig.5)の測定は46MW~227MWの間でおこない、平均電力9.6kWのときの損失は6.44Wで0.1%以下である。非常に少ない損失で、昨年より2割程度小さくなっている。この様な現象はSバンド高周波窓でもみられ高周波窓の個体差の範囲と思われる。



Fig.5 高周波窓の高周波損失

5. 発光分析

ここでCバンドとSバンドの発光パターンを比較 するとCバンド(Fig.6)の場合2∞のパルス後半か ら発光があり、Sバンド(Fig.7)では立ち上がりか らの発光が見られた。これはCバンド用に開発され た窓の特性に起因するものと思われる。このCバン ド用のMix-Mode窓⁽³⁾では端部の電界が低いため、 マルチパクタに時間がかかると推測している。



Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)

また、放電時にはCバンドでもFig.8に示すように パルス全体にわたって発光が見られた。



Fig.9は通過電力122MWで発光したときに上流側 から撮影した。この発光は窓の端部が導波管に反射 して4本の筋に見えている。



Fig.9 レゾナントリング窓上流から撮影 したときの発光分布(122MW)

6.スペクトル

通常の発光スペクトルは330nm付近に酸素のF⁺中 心が現れ、694nmのCr不純物中心に起因する基線ス ペクトルからなる。表面が溶融したものは410nmの F中心発光が見られる⁽⁴⁾。今回のCバンド窓にはF 中心のスペクトル(Fig.10)が現れなかった。



7. 通過電力と発光強度

発光は履歴依存性があり、分光器で測定した 330nmの発光強度と通過電力の関係をFig.11に示す。 最初50MW程度で発光が観測できたが、通過電力 を下げていくと発光はなくなり、再び通過電力を増 しても80MWまで発光は生じなかった。その後、 90MW程度で発光は間歇的となり、その履歴により 発光しない場合もあった。



8.まとめ

直管での通過電力は403MWに到達した。高周波 窓では最大350MWで運転され、300MWの9時間運 転において放電は3回と非常に少なく真空も時間と ともに良くなっている。

この試験評価は信頼性を上げるため発光分析等も 行った。今回の試験はSバンドの高周波窓では限界 に近い通過電力だがCバンドの高周波窓はMix-Mode としたため大きな問題はなく、表面溶融に特徴的な 発光スペクトルは現れず、窓本体の真空漏れもな かった。

今後この窓は再度組立てを行った上で加速管組立 て室の導波管高周波窓として使用する予定である。 現在稼動中のCバンドのクライストロン窓に真空漏 れがなければCバンド用高周波窓の開発は一段落と なる。

参考文献

- 福田茂樹,他、"SuperB計画の為のKEK電子陽電子ラ イナックCバンド化計画",第28回リニアック技 術研究会論文集、東海、茨城、2003.
- [2]竹中たてる.他, "C-バンド-レゾナントリングを用い た大電力試験", 第28回リニアック技術研究会論文 集、東海、茨城、2003.
- [3] 道園真一郎.他,"Cバンド・ミックスモード高周波 窓の開発",第28回リニアック技術研究会論文集、 東海、茨城、2003.
- [4]S.Michizono et al., IEEE Trans. on Electr. Insul., 28 (1993) 692.